



機能性薄膜の製作に！

この装置は3源のスパッタリングカソードを備え、3源それぞれの個別制御が可能なスパッタリングシステムです。また、スパッタ室とは別にプラズマ処理室を設け、成膜前後のプラズマ処理を可能としております。

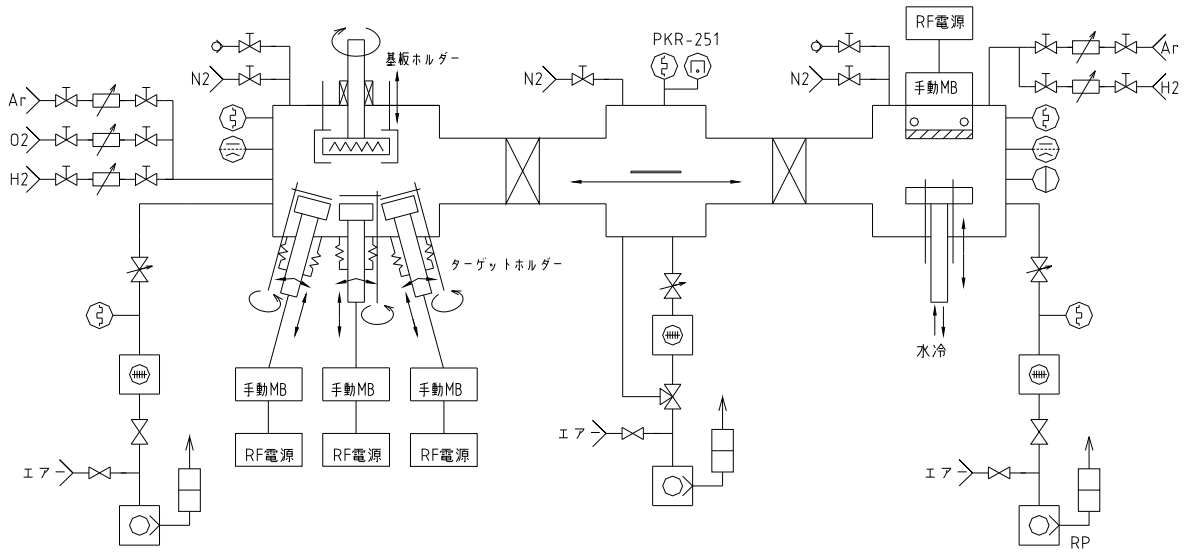
特長

1. ターゲット材は金属の他、磁性材、絶縁材にも対応します。
2. 試料ホルダーを連続回転することで均一な成膜が得られます。
3. 仕込室から成膜室、プラズマ処理室へは、トランスファーアームにより搬送でき、連続した一連の成膜作業が行えます。

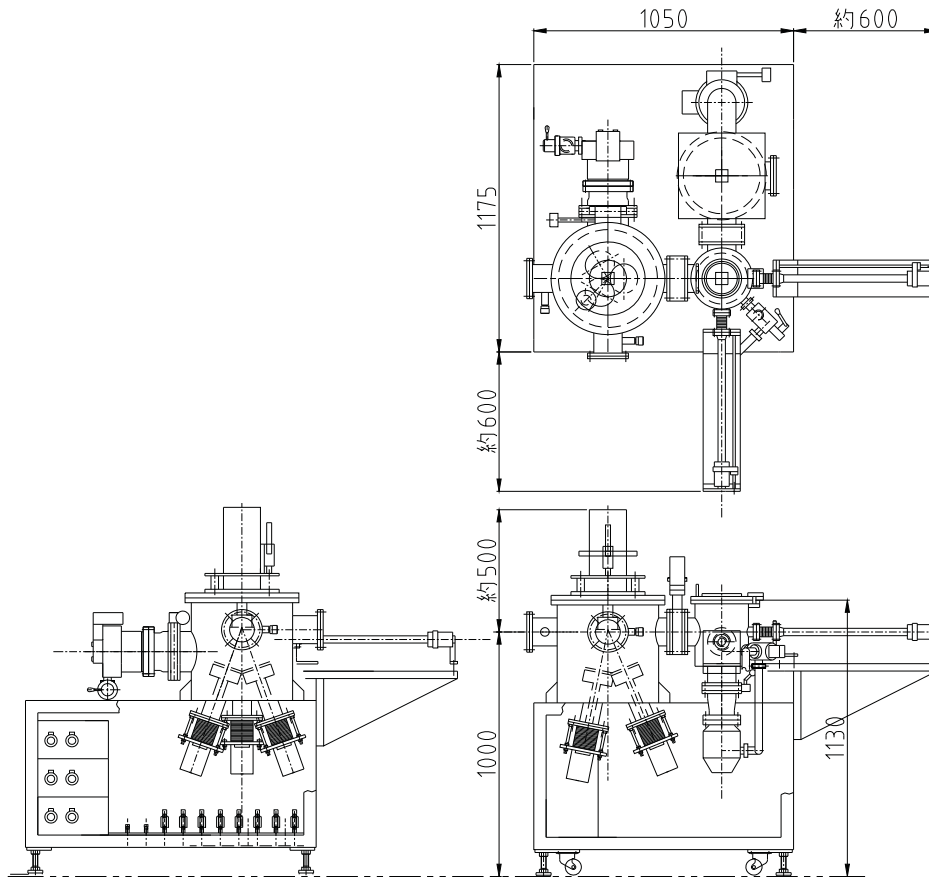
仕様

基板サイズ	50 mm × 50 mm × 1t 1枚
ターゲットサイズ	3 インチ × 3 基
基板加熱温度	RT ~ 600°C
膜厚分布	φ50 以内で ±10%
成膜用電源	RF (13.56MHz) : 300W × 3 基 手動整合器付き
ガス系	3 系 (Ar · O ₂ · H ₂) MFC 付き
真空排気系	ターボ分子ポンプ : 500L/sec + ロータリーポンプ : 250L/min
その他の機構	ICP プラズマ処理室 RF (13.56MHz) : 600W × 1 基 手動整合器付き
お問合せ番号	03 D 030

装置フローシート



装置外観図



Cryovac

〒555-0013

大阪市西淀川区千舟2丁目1番14号

TEL : 06-6475-5266(代)

FAX : 06-6475-7330

URL : <http://www.cryovac.jp>

株式会社 **クライオバック**